This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-157419

(43)Date of publication of application: 30.06.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/30

G03F 7/20

(21)Application number: 61-303987

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

22.12.1986

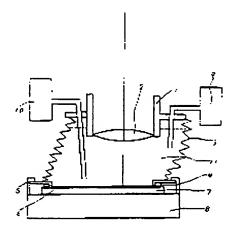
(72)Inventor: NAKASUJI MAMORU

(54) FINE PATTERN TRANSFER APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve resolution by making use of a refraction index of liquid, on the occasion of transferring fine pattern using the light, by filling an optical path between the final lens and specimen with a liquid and reducing defocusing of light by refraction.

CONSTITUTION: A bellows 3 is attached to the outside of optical barrel 1, shielding the light progressing space from outside. The interior 11 of bellows 3 is filled with a liquid having a high refraction index and the liquid is sealed by an O ring 4 not to release to the outside. Here, a lens 2 is designed so as to match the refraction index to the specimen 6 with the refraction index of liquid. When refraction index of liquid is considered as n, wavelength becomes 1/n and n times of resolution can be obtained. Here, the specimen is fixed flat by a chuck plate 7 and the O ring is clamped by a tightening jig 5. The specimen can also be moved in the x and y directions by a stage 8. Upon completion of transfer, a purge apparatus 10 operates, exhausting the liquid, and thereby a wafer may be exchanged.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

⑩日本国特許庁(JP)

(1)特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-157419

@Int.Cl.4

識別記号 311 庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)6月30日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 L-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

②発明の名称 微細パターン転写装置

②特 顧 昭61-303987

愛出 願 昭61(1986)12月22日

62発 明 者 中 筋

链 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

⑪出願人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

20代 理 人 并理士 則近 憲佑

外1名

明 相

1. 発明の名称

微細パターン転写装置

2 特許請求の範囲

(I) 光あるいは紫外線で試料上に敬細パターンを 転写する装置において、最終レンズと試料間の光 の通路を被体で満したことを特徴とする敬細パタ ーン転写装置。

(2) レンズと試料間の空間に液体を高速で充満させあるいは高速でパージさせる装置を備えたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の敬細パターン転写装置。

(3) ベローズ及び O リングで光の通路を含む空間を密閉できることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の数細パターン転写装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産薬上の利用分野)

この発明はサブミクロンパターンをウェーハ等 の試料に形成する敬細パターン転写姿質に関する。

(従来の技術)

従来、光を用いて数細パターンを転写する場合 回折による限界があるため、開口を大きくすると か、短波長の光を用いる等の工夫が行われている が十分とは言えないのが現状である。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、 回折による光のポケを低波した敬細パターン転写 毎世を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

従来、函数銭の対物レンズとは料間にオイル等の液体を満たせば高解像になることはすられている。この原理をステッパーあるいはアライナに応用する。この時間題になるのは、顕微と異なりは大きく視野も10m角程度と大きしたが開発となる。は、大きに対して、大きいの場合、は料でステップである。とし、これでは、大きな必要がありこの対策も必要である。

特開昭63-157419(2)

本発明では高屈折率の液体を用い回折を小さくし、 0 リングとベローズで光の通る空間を密閉し液体を充満可能にし、ベローズでレンズと試料が動く余裕を作った。

(作用)

本発明に於いて、例えば屈折率が 1.5 の液体を用いれば放長が 1/1.5になり、回折が 1/1.5になるので、例えば 0.5 μ mの解像度を持つ光学系を用いれば 0.3 3 μ m に解像度を上げることができる。(実施例)

本発明の一実施例による数細パターンの転写装置の構造を第1回に示す。光学系の鋭筒1の外部にはベローズ3が取付けられ、光が通る空間と外部は遮断されている。ベローズの内部11には高畑折率の液体が満されていて、〇リング4によって、外部へ偏れないようシールを打ている。レンズ2は試料6との間の空間の屈折率が液体のそれに合うよう設計されている。試料はチャック板7によってフラットに固定され、〇リングは締め具5で押えられている。試料はステージ8によって

× , y 方向に移動できる。 転写が完了すると、 パージ 装置 1 0 が作動して液体を迫出し、ウェーハが交換される。 その扱液体供給装置 9 が作動して液体を充満させた後転写が行われる。

[発明の効果]

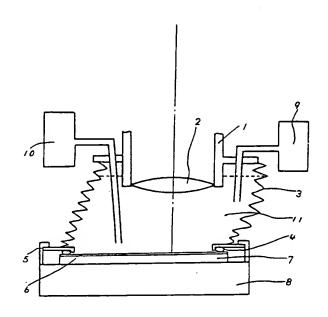
本発明によれば次の効果を奏する。

- (1) 液体の屈折率を口とすると口倍の解像力が得られる。
- (2) ベローズでシールされているためxy方向に 移動が可能である。
- (3) 高速で液体をパージしたり、供給したりする 装置を持つのでスループットが落ちない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による転写装置の一実施例の主要部を示す断面図である。

1 … 光学鏡筒、 2 … 及終レンズ、 3 … ベローズ、 4 … O リング、 5 … O リング押え会具、 6 … 試料 ウェーハ、 7 … チャック板、 8 … × y ステージ、 9 … 液体供給装置、 1 0 … 液体パージ装置。



8 1 73